

小 特 集

半導体産業におけるレーザーアニール装置と技術

LTPS TFT 製造用固体グリーンレーザーアニール装置	1
玉川孝一	
ダブルパルス制御方式の固体レーザーアニール技術 ハイパワートランジスタの裏面活性化プロセスへの応用	5
工藤利雄	
パワー半導体デバイス向けレーザーアニール技術の開発	10
松野 明, 伊藤 健, 金子 智, 榆 孝	
レーザーによる薄膜トランジスタ形成	16
鮫島俊之	
単結晶シリコンの吸収係数温度依存性測定	22
福世文嗣, 大村悦二, 福満憲志, 森田英毅	
集光ビーム繰り返し照射下における第二高調波発生の温度分布解析とその高変換効率化の検討	27
野村和史, 大村悦二, 平田好則	
レーザーの多重反射と蒸発を考慮したレーザー穴あけ加工の熱流体解析 第1報 光線追跡を用いたレーザーの多重反射シミュレーション	33
野口 暁, 大村悦二, 平田好則	
フェムト秒レーザーパルスを用いた異種透明材料のレーザーマイクロ溶接	39
玉木隆幸, 渡辺 歴, 音田智史, 伊東一良	
フェムト秒レーザーによるサファイア基板の3次元加工 次世代レーザースクライバの開発を目指して	42
三澤弘明	
レーザーピックアップ	45
レーザー関連カレンダー	49
第66回レーザー加工学会講演要旨	54
会告	61
LPM2007	63

解 説

学 術 論 文

新製品・新技術紹介